

平成 17 年 8 月 5 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ホ ロ ン  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 富 加 津 好 夫  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 7 7 4 8 )  
( U R L <http://www.holon-ltd.co.jp/> )  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 総 務 部 長 川 崎 成 二  
電 話 0 3 ( 3 3 4 1 ) 6 4 3 1 ( 代 表 )

### 新製品発売に関するお知らせ

当社は、( 1 ) 新製品 EMU-270、( 2 ) DIS-05 を開発し、下記の通り発売開始することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1 . 新製品名

- ( 1 ) 微小寸法測定装置 EMU-270 "Wind-SEM"
- ( 2 ) 超解像欠陥検査装置 DIS-05

#### 2 . 新製品の内容

- ( 1 ) 現製品 EMU-250/260 ( 65 nm 対応 ) の後継機であり、45 nm に対応するもの。
- ( 2 ) マスク上のパターン欠陥を検査する電子顕微鏡。

#### 3 . 新製品の発売開始の時期

- ( 1 ) 平成 17 年 9 月開始予定
- ( 2 ) 平成 17 年 9 月開始予定

#### 4 . 新製品の特長

##### ( 1 ) EMU-270

- ・ チャンバー内の圧力を高く保ち、チャンバー内に一定の風を与えることにより、電子ビームの照射により発生するチャージアップ ( 帯電の発生 ) の抑制に大きな効果を発揮する。( "Wind" 方式 )
- ・ 全てのマスクを安定して計測でき、測定再現性 ( 同一の方法で、同一の測定対象を、測定場所等が異なった条件で測定した場合、個々の測定値が一致する度合 ) などの性能が向上したものの。
- ・ 既に当社が所有しているソフトウェア EMU-navi のパターン認識ソフトを改良することにより、EMU-270 上で測定のレシピを作成する必要がなくなり、測定の完全自動化が可能になった。

##### ( 2 ) DIS-05

- ・ 従来の C D S E M では測定位置を正確に測定できないパターン及び単純な「長さ」や

「幅」では測定できないパターンを検査するもの。

- ・ 設計パターンとマスクに描画されたパターンの違いを検出したり、マスクに描画された同一パターンの比較を行うことによって欠陥の有無を検査するもの。(形状を検査するもの)

#### 5. 新製品の売上高等への影響

EMU-270 の売上は、当期の業績等への影響については折り込んでおります。DIS-05 につきましては、新しいコンセプトの製品で、これから売り込みを開始するものであり現段階における当期の業績等への影響は不明であります。

当期の業績予想につきましては、本日(平成 17 年 8 月 5 日)別途開示しております「平成 18 年 3 月期業績予想修正に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上